PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-207123

(43) Date of publication of application: 31.07.2001

(51)Int.CI.

CO9D185/00 B05D 5/00 B05D 5/08 CO9D 5/00 CO9D201/00 CO9K 3/18 // CO9D133/00 CO9D183/02

(21)Application number : 2000-268026

(71)Applicant: SENTAN KAGAKU GIJUTSU

INCUBATION CENTER:KK

(22)Date of filing:

05.09.2000

(72)Inventor: NAKAJIMA AKIRA

WATABE TOSHIYA

HASHIMOTO KAZUHITO

FUJISHIMA AKIRA

(30)Priority

Priority number: 11326093

Priority date: 16.11.1999

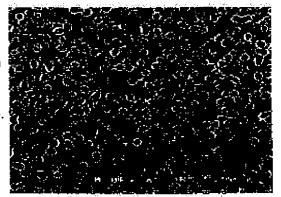
Priority country: JP

(54) FILM HAVING HIGH HARDNESS AND HIGH DROPLET SLIDABILITY AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a film structure having both droplet slidability and hardness, to provide a method for producing the same, and to provide a coating material.

SOLUTION: This coating material comprises a solution or emulsion obtained by adding, to a solvent, a metal alkoxide and/or a sol having a primary particle diameter of ≤100 nm and a substance having characteristics which phase-splits from the above components and decomposed, burns or sublimes at a temperature of room temperature to 700° C. The film having high hardness and high droplet slidability is obtained by coating a substrate with the coating material, thermally treating the coated substrate in a temperature range of room temperature to 700° C to form the primary layer having many fine holes having an average hole diameter of 100 nm to 2 µm, and then coating at least one portion of the primary layer with a water-repelling agent.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

BEST AVAILABLE COPY

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-207123 (P2001-207123A)

(43)公開日 平成13年7月31日(2001.7.31)

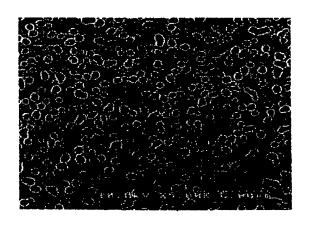
			(W) ADD H	1 70410 1	1 /10	71 (E001: 1:01)	
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ			テーマコード(参考)		
C 0 9 D 185/00		C 0 9 D 18	5/00			4D075	
B05D 5/00		B05D	5/00		В	4H020	
5/08		!	5/08		Z	4J038	
C 0 9 D 5/00		C09D	5/00		Z		
201/00		201/00					
	審查請求	未請求 請求項	真の数26 O	L (全 9	頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	特願2000-268026(P2000-268026)	(71)出願人	899000024				
			株式会社	先端科学技	支術イ	ンキュペーショ	
(22)出顧日	平成12年9月5日(2000.9.5)		ンセンター	-			
			東京都千代	田区丸の	オー丁	目5番1号 新	
(31)優先権主張番号	特願平11-326093		丸の内ビル	チング6月	昔		
(32)優先日	平成11年11月16日(1999.11.16)	(72)発明者	中島 章				
(33)優先権主張国	日本 (JP)		埼玉県浦和	市白幡4	丁目20	番1号 白幡西	
			住宅4-10	02			
		(72)発明者	渡部 俊也	1			
		神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目15番7号					
		(74)代理人	100091384				
			弁理士 件	学 俊光			
						最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 高硬度高滑水性膜およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 滑水性と硬度を兼ね備えた膜構造体、および その作製方法と塗布剤を提供する。

【解決手段】 金属アルコキシド及び/又は一次粒子径 100 n m以下のゾルと、溶媒中でとれらと分相し且つ 室温から700℃までの温度で分解、燃焼、昇華する特性を有する物質が溶剤に添加された溶液もしくはエマルションを作製し、これを基材に塗布して、室温から700℃までの温度範囲で熱処理することにより、平均孔径 100 n m~2 μ mの微小多孔を多数有する下地層を形成し、この下地層の少なくとも一部分に撥水剤を塗布することにより滑水性を出す。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 実用的な硬度と高滑水性とを併せ持つ高 硬度高滑水性膜。

1

【請求項2】 以下の特性を備える高硬度高滑水性膜。 接触角が140°以上、

7mgの液滴の転落角が30°以下、並びに、 硬度が、鉛筆硬度で3H以上。

【請求項3】 表面に平均孔径100nm~2μmの微 小孔を多数備える微小多孔層を備えた髙滑水性膜であ る、請求項1または2に記載の高硬度高滑水性膜。

【請求項4】 表面に撥水処理が施された、平均孔径1 00 n m~2 μ mの微小孔を多数備えた微小多孔層から なる高硬度高滑水性膜。

【請求項5】 透明膜である、請求項1から4のいずれ かに記載の高硬度高滑水性膜。

【請求項6】 分相を用いて形成された平均孔径100 nm~2μmの細孔を有する多孔質の下地層と、その表 面の少なくとも一部に透明撥水層が形成されていること を特徴とする高硬度高滑水性膜。

第1の凹凸面と、第1の表面粗さよりも小さい第2の表 面粗さにて第1の凹凸面上に形成された第2の凹凸面と の二重表面粗さを有する面に形成されていることを特徴 とする高硬度高滑水性膜。

【請求項8】 第1の表面粗さが100nm~2 μmの 範囲にあり、第2の表面粗さが100nm未満である、 請求項7 に記載の高硬度高滑水性膜。

【請求項9】 第1の凹凸面が分相を用いて形成された ものであり、第2の凹凸面が、分相又は含有粒子を用い て形成されたものである、請求項7または8に記載の高 30 硬度高滑水性膜。

【請求項10】 第1の凹凸面が、より大きな粒子径の 粒子または凝集粒子を用いて形成されたものであり、第 2の凹凸面が、より小さな粒子径の粒子または一次粒子 を用いて形成されたものである、請求項7または8に記 載の高硬度高滑水性膜。

【請求項11】 透明膜である、請求項7から10のい ずれかに記載の高硬度高滑水性膜。

表面の少なくとも一部に撥水層が形成 【請求項12】 されている、請求項7から11のいずれかに記載の高硬 40 度高滑水性膜。

【請求項13】 光触媒が分散されている、請求項1か 512のいずれかに記載の高硬度髙滑水性膜。

【請求項14】 膜基材の原料液、所定の溶媒、及び、 前記膜基材の原料液が固化した後に除去される物質と で、分相を形成したものからなる高硬度高滑水性膜形成 用塗布剤の原液。

【請求項15】 金属アルコキシドと、所定の溶媒中で 当該金属アルコキシドと分相し且つ室温から700℃ま での温度で除去される特性を有する物質と、が溶剤に添 50

加された溶液もしくはエマルションからなる、高硬度高 滑水性膜形成用の塗布剤。

【請求項16】 金属アルコキシドと、一次粒子径10 0 n m以下のゾルと、所定の溶媒中でこれらと分相し且 つ室温から700℃までの温度で除去される特性を有す る物質と、が溶剤に添加された溶液もしくはエマルショ ンからなる、高硬度高滑水性膜形成用の塗布剤。

【請求項17】 前記ゾルがコロイダルシリカゾルから なる、請求項16に記載の高硬度高滑水性膜形成用の塗 布剤。

【請求項18】 金属アルコキシドと、所定の溶媒中で これと分相し且つ室温から700℃までの温度で除去さ れる特性を有する、分相状態での分散径が100nm以 上の物質及び100nm未満の物質と、が溶剤に添加さ れた溶液もしくはエマルションからなる、高硬度高滑水 性膜形成用の塗布剤。

【請求項19】 請求項15から18のいずれかに記載 の塗布剤を基材に塗布した後、室温から700℃までの 温度範囲で熱処理することにより微小多孔質の下地層を 【請求項7】 表面が、第1の表面粗さにて形成された 20 形成し、この下地層の少なくとも一部分に撥水剤を塗布 することによって基材上に高硬度高滑水性膜を形成する 方法。

> 【請求項20】 粒子径が100nm以上の粒子または 凝集粒子と、粒子径が100mm未満の粒子または一次 粒子とを含む、高硬度高滑水性膜形成用の塗布剤。

> 【請求項21】 請求項20に記載の塗布剤を基材に塗 布して、粒子径が100nm以上の粒子または凝集粒子 により形成された、第1の表面粗さにて形成された第1 の凹凸面と、粒子径が100mm未満の粒子または一次 粒子により形成された、第1の表面粗さよりも小さい第 2の表面粗さにて第1の凹凸面上に形成された第2の凹 凸面との二重表面粗さを有する面をもつ下地層を形成 し、この下地層の少なくとも一部分に撥水剤を塗布する ことによって基材上に高硬度高滑水性膜を形成する方

> 【請求項22】 平均孔径100nm~2μmの微小孔 を多数備える微小多孔層の表面に撥水処理を施すことに よって髙滑水性膜を作製する方法。

> 【請求項23】 第1の表面粗さを有する第1の凹凸面 と、第1の表面粗さよりも小さい第2の表面粗さで第1 の凹凸面上に形成された第2の凹凸面との二重表面粗さ を有する基材表面に撥水処理を施すことによって高滑水 性膜を作製する方法。

【請求項24】 第1の凹凸面が表面粗さ100nm~ 2μmの範囲にあり、第2の凹凸面が表面粗さ100n m未満である、請求項23 に記載の方法。

【請求項25】 請求項19から24のいずれかに記載 の方法において、フッ素系の撥水剤を塗布することを特 徴とする方法。

【請求項26】 請求項15から18のいずれかに記載 3

の塗布剤を用い、前記分相の状態の調整及び/又は熱処 理工程の調整を行うことにより、最終的に得られる滑水 性膜の滑水性強度の調整及び/又は硬度の調整を行う方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、構造制御が容易で、優れた滑水性と硬度とを同時に備えた膜構造体およびその作製方法およびそれに用いられる塗布剤に関する。

[0002]

【従来の技術】多くの滑水性表面は、従来よりシリコンやフッ素等で表面を処理することによって得られており、このような従来技術によって得られる滑水性表面は、水との接触角が100~110°程度で、液滴の転落角は20mgの液滴に対して50~60°程度のものであった。そしてこの処理は、衣料品や車のガラス、塗装面等に対して既に実用化されている。

【0003】この一方で、低エネルギー表面に適当な構造を持たせることにより、その表面と水との接触面積を20著しく小さくすることができ、接触角が150°以上の極めて高い撥水性(超撥水性)を備える表面が得られるということが知られている。そして、この超撥水性表面がそのまま高い滑水性を示すのであれば、着雪雨滴防止、汚れ防止、防錆、電気絶縁性、離型性など様々な目的に対して、高い効果を期待することができる。

【0004】しかしながら、この超撥水性という性質と水滴が転落する性質(滑水性)との間には単純な相関関係があるというわけではなく、高い滑水性を付与するためには(わずか数度の傾きで水滴が転落するほどにまで 30表面と水との抵抗を下げるためには)、表面が超撥水性を備えるというだけでは不十分である。

【0005】このようなことから、ほんの数度程度の傾きでも水滴が転落するほどの高い滑水性を表面に付与するべく本発明者らが研究を行った結果、超撥水性膜の表面を微細な凹凸構造とすることによって、わずか1度程度の傾きでも水滴が転落するほどの高い滑水性を有する膜(超撥水性膜)を得ることに成功した(特願平11-294636号)。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような超撥水性膜を得るためには、基本的には微細な凹凸構造を表面に形成することが必要となるので、このことに起因して膜自体の硬度が低下してしまい、それが超撥水性膜の実用化を遅延させる原因となっている。

【0007】本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、構造制御が容易で、優れた硬度と滑水性とを同時に兼ね備えた膜構造体およびその製造方法、並びに、当該製造方法に用いられる塗布剤を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】以上のような目的を達成するために、本発明においては、平均孔径100nm~2μmの微小孔を多数有する微小多孔質の下地層を分相を用いて形成し、この下地層に撥水処理を行うことによって高硬度高滑水性膜を作製することを特徴とする。

【0009】また、本発明においては、超撥水性をさらに向上するために、基材の表面が、第1の表面粗さにて形成された第1の凹凸面と、第1の表面粗さよりも小さい第2の表面粗さにて第1の凹凸面上に形成された第2の凹凸面との二重表面粗さを有する面に形成されており、この下地層に撥水処理を行うことによって高硬度高滑水性膜を作製することを特徴とする。この二重表面粗さの面の形成においては、上記と同様の分相を用いて第1の凹凸面を形成するとともに、さら細かい分散径の分相、または、微粒子を用いて第2の凹凸面を形成することができる。

【0010】このような要求を満たす高硬度高滑水性膜の作製方法としては、たとえば、金属アルコキシド及び/又は一次粒子径100nm以下のゾルと、溶媒中でこれらと分相し、且つ室温から700℃までの温度で分解、燃焼、昇華する特性を有する物質が、溶剤に添加された溶液もしくはエマルションを作製し、これを用いて常温(室温)で膜を作製した後、室温から700℃までの温度で一定時間保持し、上記物質を除去する方法を挙げることができる。更には、大きさ(粒子径)の異なる粒子の配合、あるいは、粒子の凝集径制御などでも上記要求を満たすことが可能である。

【0011】撥水処理は、フッ素やシリコーン系の撥水 剤またはこれらを適宜組み合わせたものを用いることが 可能である。また、本発明に係る高硬度高滑水性膜に自 己清浄性を付与するために、前記多孔質の下地層に光触 媒を含有させることも可能である。

【 0 0 1 2 】より具体的には、本発明は以下のようなものを提供する。

【0013】(1) 実用的な硬度と高滑水性とを併せ持つ高硬度高滑水性膜。

【0014】(2)次の特性を備える高硬度高滑水性 障

10 接触角が140°以上、7mgの液滴の転落角が30°以下、並びに、硬度が鉛筆硬度で3H以上。なお、転落角について言えば、好ましくは20°以下、より好ましくは15°以下である。また、硬度について言えば、好ましくは鉛筆硬度で5H以上、より好ましくは鉛筆硬度で6H以上である。なお、これらの転落角及び硬度については、いずれも本発明を適用することにより達成できるものである。

【0015】(3)表面に平均孔径100nm~2μm の微小孔を多数備える微小多孔層を備えた高滑水性膜で 50 ある(1)または(2)に記載の高硬度高滑水性膜。

【0016】(4)表面に撥水処理が施された、平均孔 径100nm~2μmの微小孔を多数備えた微小多孔層 からなる高硬度高滑水性膜。

【0017】(5)透明膜である(1)から(4)のい ずれかに記載の高硬度高滑水性膜。

【0018】(6)分相を用いて形成された平均孔径1 00nm~2μmの細孔を有する多孔質の下地層と、そ の表面の少なくとも一部に透明撥水層が形成されている ことを特徴とする高硬度高滑水性膜。

【0019】(7)表面が、第1の表面粗さにて形成さ れた第1の凹凸面と、第1の表面粗さよりも小さい第2 の表面粗さにて第1の凹凸面上に形成された第2の凹凸 面との二重表面粗さを有する面に形成されていることを 特徴とする高硬度高滑水性膜。

【0020】(8)第1の表面粗さが100nm~2 μ mの範囲にあり、第2の表面粗さが100nm未満であ る、(7)に記載の高硬度高滑水性膜。第2の表面粗さ の下限値は特に限定しないが、該表面粗さによる凹部に 空気を介在させて超撥水性をより向上させるという面、 および、分相や微粒子含有を利用して第2の表面粗さを 20 ションからなる、高硬度高滑水性膜形成用の塗布剤。 実用的に形成するという面からは、第2の表面粗さの下 限値は1 n m程度、より好ましくは3 n m程度である。 【0021】(9)第1の凹凸面が分相を用いて形成さ れたものであり、第2の凹凸面が、分相又は含有粒子を 用いて形成されたものである(7)または(8)に記載 の高硬度高滑水性膜。

【0022】(10)第1の凹凸面が、より大きな粒子 径の粒子または凝集粒子を用いて形成されたものであ り、第2の凹凸面が、より小さな粒子径の粒子または一 次粒子を用いて形成されたものである(7)または (8) に記載の高硬度高滑水性膜。

【0023】(11)透明膜である、(7)から(1 0)のいずれかに記載の高硬度高滑水性膜。

【0024】(12)表面の少なくとも一部に撥水層が 形成されている、(7)から(11)のいずれかに記載 の高硬度高滑水性膜。

【0025】(13)光触媒が分散されている(1)か ら(12)のいずれかに記載の高硬度高滑水性膜。

【0026】とのように光触媒(代表的には酸化チタ ン)を分散させる(好適には、微小多孔質の下地層に分 40 散させる) ことにより、本発明の高硬度高滑水性膜に自 己清浄性(特願平11-294637号)を付与すると とができる。

【0027】(14) 膜基材の原料液、所定の溶媒、及 び、前記膜基材の原料液が固化した後に除去される物質 とで、分相を形成したものからなる高硬度高滑水性膜形 成用塗布剤の原液。

【0028】本発明においては、この原液を所定の溶剤 に溶解させることにより、高硬度高滑水性膜形成用の塗 布剤を作製する(具体的な態様の例は、下記の(15)

~(18)に示されている)。とこで、「膜基材の原料 液」は、他の成分との間で分相を形成し得るものであっ て、かつ、最終的に得られる滑水性膜に実用的な硬度を 与えることができるものであれば如何なるものであって もよく、一例としては、ゾルーゲル法の原料となる金属 アルコキシドが挙げられる。また、「膜基材の原料液が 固化した後に除去される物質」としては、室温から70 0℃までの温度で除去される特性を有する物質(特に、 室温から700℃までの温度で分解、燃焼、昇華する特 10 性を有する物質)を一例として挙げることができる。

【0029】(15)金属アルコキシドと、所定の溶媒 中で当該金属アルコキシドと分相し且つ室温から700 ℃までの温度で除去される特性を有する物質と、が溶剤 に添加された溶液もしくはエマルションからなる、高硬 度髙滑水性膜形成用の塗布剤。

【0030】(16)金属アルコキシドと、一次粒子径 100 n m以下のゾルと、所定の溶媒中でこれらと分相 し且つ室温から700℃までの温度で除去される特性を 有する物質と、が溶剤に添加された溶液もしくはエマル

【0031】「室温から700℃までの温度で除去され る特性」というのは、たとえば、かかる温度において分 解、燃焼、昇華する特性のことを意味し、このような特 性を備える物質群 (たとえば、熱昇華性物質の一群) の 中から、他の成分との間で分相を形成し得るものが適宜 選択されることとなる。このようなものとしては、有機 ポリマー (一般に、これは熱によって分解・燃焼する) であって、金属アルコキシドに不溶で、エタノールや酢 酸エチルなどの所定の溶媒に溶解するようなものを挙げ 30 ることができる。

【0032】(17)前記ゾルがコロイダルシリカゾル からなる、(16)に記載の高硬度高滑水性膜形成用の 塗布剤。

【0033】(18)金属アルコキシドと、所定の溶媒 中でこれと分相し且つ室温から700℃までの温度で除 去される特性を有する、分相状態での分散径が100 n m以上の物質及び100nm未満の物質と、が溶剤に添 加された溶液もしくはエマルションからなる、高硬度高 滑水性膜形成用の塗布剤。

【0034】(19)(15)から(18)のいずれ記 載の塗布剤を基材に塗布した後、室温から700℃まで の温度範囲で熱処理することにより微小多孔質の下地層 を形成し、この下地層の少なくとも一部分に撥水剤を塗 布することによって前記基材上に高硬度高滑水性膜を形 成する方法。

【0035】さらに本発明においては、以下のように異 なる大きさの粒子を含有する塗布剤、およびその塗布剤 を用いて高硬度高滑水性膜を形成する方法を適用すると とも可能である。

50 【0036】(20)粒子径が100nm以上の粒子ま

たは凝集粒子と、粒子径が100mm未満の粒子または 一次粒子とを含む、高硬度高滑水性膜形成用の塗布剤。 【0037】(21)上記(20)に記載の塗布剤を基 材に塗布して、粒子径が100 n m以上の粒子または凝 集粒子により形成された、第1の表面粗さにて形成され た第1の凹凸面と、粒子径が100nm未満の粒子また は一次粒子により形成された、第1の表面粗さよりも小 さい第2の表面粗さにて第1の凹凸面上に形成された第 2の凹凸面との二重表面粗さを有する面をもつ下地層を 形成し、との下地層の少なくとも一部分に撥水剤を塗布 10 により、硬度及び滑水性の点で優れた膜が作製できると することによって基材上に高硬度高滑水性膜を形成する 方法。

【0038】さらに本発明においては、以下のような方 法を採用できる。

(22) 平均孔径100nm~2μmの微小孔を多数備 える微小多孔層の表面に撥水処理を施すことによって高 滑水性膜を作製する方法。

【0039】(23)第1の表面粗さを有する第1の凹 凸面と、第1の表面粗さよりも小さい第2の表面粗さで 第1の凹凸面上に形成された第2の凹凸面との二重表面 20 粗さを有する基材表面に撥水処理を施すことによって高 滑水性膜を作製する方法。

【0040】(24)第1の凹凸面が表面粗さ100n m~2μmであり、第2の凹凸面が表面粗さ100nm 未満である、(23) に記載の方法。

【0041】(25)(19)から(24)のいずれか に記載の方法において、フッ素系の撥水剤を塗布すると とを特徴とする方法。

【0042】(26)(15)から(18)のいずれか に記載の塗布剤を用い、前記分相の状態の調整及び/又 30 は熱処理工程の調整を行うことにより、最終的に得られ る滑水性膜の滑水性強度の調整及び/又は硬度の調整を 行う方法。

[0043]

【発明の実施の形態】本発明の理解を容易にするため実 施の形態について具体的かつ詳細に説明する。良好な滑 水性を得るためには、傾斜した面を液滴が転落する際の 前進接触角(液滴の前進側における接触角)と後退接触 角(液滴の後退側における接触角)の差を小さくすると とが望ましく、そのためには膜に一定の粗さを付与し、 その面を撥水化して空気の噛み込みによる寄与を多くす ることが効果的である(Johnson Jr., R. E. & Dettre, R. H. Contact Angle Hysteresis, I. Studyof an Ide al Rough Surface, Adv. Chem. Ser., 43, 112-135, (1 963))。

【0044】具体的には、良好な滑水性を得るためには 表面構造を針状にすることが最も望ましいが、そのよう な構造では表面の硬度を維持することができない。この ようなことに鑑みて本発明者らは、滑水性と撥水性を維 持し、且つ膜に実用可能な硬度を持たせるために、膜表 50 【0050】〔光触媒〕添加することが可能な光触媒材

面の構造について鋭意検討を行った結果、金属アルコキ シド及び/又は一次粒子径100nm以下のゾルと、溶 媒中でこれらと分相し且つ室温から700℃までの温度 で分解、燃焼、昇華する特性を有する物質が溶剤に添加 された溶液もしくはエマルションを作製した。そして、 これを用いて常温で膜を作製した後、室温から700℃ までの温度で一定時間保持することにより、相分離に伴 う平均孔径100 n m~2 μ mの微小孔を多数有する微 小多孔質の構造が形成され、これに撥水処理を行うこと とを見出した。

【0045】本発明で得られる膜は、微小多孔質の膜で あるため、滑水性や撥水性を損なうことなく高い硬度を 得ることができている。膜の構成体は、大きさや溶解性 の条件を満たしてさえいれば、複数の物質を組み合わせ たものであってもよい。

【0046】本発明で使用可能な膜の材質は主に無機材 料であるが、適当な硬度や耐熱性を有するものであれば 有機材料であってもよい。膜の作製方法は、主にはスピ ンコート、ディップコート、スプレー法等の湿式法であ る。室温から700℃までの温度で分解、燃焼、昇華す る物質も無機物であると有機物であるとに限定されな

【0047】また、本発明においては、たとえば上記と 同様の多孔層形成方法により基材の表面に第1の凹凸面 を形成すると同時に、第1の凹凸面上にさらに細かい第 2の凹凸面を形成した二重表面粗さを有する面を形成す ることもできる。この構造によって、さらに細かい空気 介在層を形成して撥水性を一層高めつつ、高い表面硬度 を同時に達成することが可能になる。第2の凹凸面を形 成する第2の表面粗さを達成する方法としては、コロイ ダルシリカ等の微粒子を含有することによって形成する 方法、前述の分相よりもさらに細かい分散径にて分相さ せた物質を、分解や燃焼、昇華により除去して、より細 かい多孔構造を上のせする方法等を採用できる。

【0048】 〔撥水剤〕撥水剤としては、フッ素やシリ コーン系の撥水剤またはこれらの組み合わせを用いるこ とが可能であるが、フッ素を含有したものが表面エネル ギーを低下させる効果が大きいために好ましく、特にフ ルオロアルキルシランが好ましい。この他、パーフルオ ロアルキルカルボン酸系、パーフルオロアルキルスルホ ン酸系、パーフルオロアルキルリン酸系等の表面処理 剤、パーフルオロアルキル基含有オリゴマー、ポリテト ラフルオロエチレン (PTFE) に代表される各種フッ 素系樹脂、フッ化グラファイト、フッ化ピッチ等も使用 可能である。

【0049】撥水処理は、微小多孔質の下地層同様、湿 式法が効率やコストの点で最も優れるが、原料によって は蒸着法やスパッタ法で行うようにしてもよい。

料としては酸化チタン、酸化錫、酸化亜鉛、チタン酸ス トロンチウム、酸化タングステン、酸化鉄、酸化銅のう ち一種類若しくは複数を組み合わせて使用できる。これ らの前駆体としては、これらの光触媒を加熱により生じ る各種の無機、有機化合物が挙げられ、例えば酸化チタ ンの場合は水酸化チタン、チタンテトラプロポキシド等 のチタンアルコキシド類、塩化チタン、硫化チタン、臭 化チタン、ヨウ化チタン、ビスシクロペンタジエニルチ タン、ジカルボニルビスシクロペンタジエニルチタン、 クロロビスシクロペンタジエニルチタン、ジクロロビス 10 シクロペンタジエニルチタン、ジメチルビスシクロペン タジエニルチタン、トリクロロシクロペンタジエニルチ タン、テトラベンジルチタンなどが挙げられる。

【0051】ととで、膜の構成体は大きさや溶解性の条 件を満たしていれば、複数の物質を組み合わせたもので あってもよいが、例えば酸化チタン光触媒については有 機撥水剤を分解する性質を備えているため、酸化チタン 光触媒を膜に入れる場合にはその濃度を2 w t %程度に 調整するか(これについては、後の実施例において検証 される)、または、シリコン、アルミニウム、ジルコニ 20 えられる。 ウム等の酸化物または水酸化物もしくはそれらの混合物 で基材を構成し、これらの基材の0.5~60wt%の 範囲の量で酸化チタン光触媒を添加することが望まし い。光触媒の添加量がこれより多くなると光触媒活性は 増加するが、撥水剤の耐久性は低下してしまうために接 触角が短時間で低下することとなる。

【0052】〔滑水性〕超撥水性表面は表面と水との接 触面積を著しく小さくすることができる。静的な撥水性 は接触角で評価されるが、実用上は動的な撥水性、すな わち滑水性の方がより重要である。これは平坦な面を傾 30 けた際に液滴が転落を開始する角度(転落角)や、その 際の液滴と面がつくる前進接触角と後退接触角の差(ヒ ステリシス) で評価され、近年は接触角よりもこれらの 指標を重要視する傾向が強い。接触角が高い固体表面の 液滴の転落角が常に低いとは必ずしも限らず、接触角が 髙いにも関わらず髙い転落角を示す場合もある。例え ば、平滑なガラスにFAS-17 (CF,), CH, CH, Si (OMe),)をコーティングすると、水接触角は105°程 度、20mgの液滴での転落角は50°程度であるが、 メチルトリメトキシシランをコートしたガラスでは水接 40 触角は64°程度と低いものの、20mgの液滴の転落 角は約35°でFAS-17よりも低くなる。

【0053】〔用途〕実用的な硬度と優れた滑水性を併 せ持つ膜は、これまで適当なものが得られていなかった が、本発明によってそのような膜が提供される。

【0054】本発明に係る実用的な硬度と優れた滑水性 を併せ持つ膜は、自動車や新幹線等の乗り物の外装、船 底塗料、外灯、台所及び台所用品、浴室や洗面所とその 用品、漁業用網、ブイ、歯科用品、電気機器、住宅の床 や外装、玄関ドア及びノブ、屋根、プール及びプールサ 50 エタノール20g、テトラエチルオルソシリケート(T

イド、橋脚、門扉、ポスト、ベンチ、鉄塔、アンテナ、 電線、ガレージ、テント、傘、レインコート、スポーツ 用品およびスポーツ衣料、ヘルメット、靴や鞄などの皮 革製品、カメラ、ビデオ、紙、スピーカー等の屋外拡声 器や音響機器、カーテン、絨毯、ガソリンスタンド等の 注油ノズル、精油所等の化学プラント、金属製工具類、 釘やネジ、バケツ類等、広範囲に及ぶ応用が考えられ

[0055]

【実施例】以下、本発明の実施例を示す。

【0056】との実施例は、図1に示される3成分系の 相図中の分相域内に入るように、溶媒、金属アルコキシ ド、及びポリマーの3成分の濃度を調整し、図2に示さ れるスキームに従って、分相を形成した。得られた分相 は不均一系であり、図3に示されるように、アルコール (溶媒) とアルコキシドが溶解し合ったものの中にポリ マーの微小粒子が分散したものが形成されたと考えられ る。また、さらにシリカゾルを形成していたシリカ微粒 子(たとえば、コロイダルシリカ)が分散していたと考

【0057】上記のような分相状態にある塗布剤を熱処 理することにより、当該塗布剤の固化とポリマーの除去 を行い、撥水処理を行った結果、図4に示されるような 微小孔が多数存在する表面(微小多孔質の表面)が得ら れた(SEM写真)。なお、この微小孔の断面は、図5 に示されるようなクレーター状微小孔 1 を有する基材表 面2が形成されたと考えられる。

【0058】上記のようなクレーター状の微小孔1によ る基材表面の凹凸のみでも、超撥水性を得ることが可能 であるが、シリカゾルを添加し、コロイダルシリカ等の 微粒子を含有させることにより、上記表面凹凸上にさら に微小な凹凸を上のせすることができる。このさらなる 微小凹凸形成は、分相を用いる方法によっても形成可能 であり、上記クレーター状の凹凸形成用の分散ポリマー に比べ、さらに細かな分散径の分相形成物質を含有さ せ、それを熱処理によって除去することによっても形成 可能である。

【0059】すなわち図6にモデル図を示すように、基 材10の表面に、たとえば上述したようなクレーター状 の微小孔による第1の凹凸面11のみを形成した場合に は、その個々の凹凸部における斜面12は比較的フラッ トな面になるものの、液滴13に対し優れた撥水性を呈 する。

【0060】これに対し図7にモデル図を示すように、 基材20の表面に、たとえば上述したようなクレーター 状の微小孔による第1の凹凸面21に加え、その上によ り細かい第2の凹凸面22を形成すると、液滴23に対 しさらに優れた撥水性を発揮できるようになる。

【0061】実施例1

EOS)2g、塩酸1.2gを36時間混合し、加水分解した。この一方で、アクリルポリマーをエタノールに溶解し、固形分5.4%に調整した。そして、このアクリルポリマー/エタノール溶液を、TEOSの溶液に4g添加し、更にエタノールを4g添加した後、これにシリカゾル(コロイダルシリカ)0.12g添加することによって塗布液を調製した。この塗布液は、加水分解TEOSエタノール溶液中にアクリルポリマーが分散した分相を形成していた。

【0062】この分相塗布液をパイレックス(登録商標)ガラス上に1500回転でスピンコートし、コートー乾燥のサイクルを10回繰り返した後、500℃で30分焼成した。このようにして得られた膜には、当量の水で加水分解したフルオロアルキルシランを熱CVD法でコートすることによって撥水処理を施し、滑水性膜を作製した。

【0063】得られた滑水性膜は、平均細孔径1µmの クレーター状の微小多孔構造を有しており、さらにその 上にコロイダルシリカによるさらに細かい微小凹凸が形 成されており、接触角は157°で、7mgの液滴の転 20 落角が6.5°、鉛筆硬度で8Hの硬度を備える高硬度 高滑水性膜であった。

【0064】比較例1

アセチルアセトンアルミニウムのエタノール溶液(2.37 w t %)に硝酸含有ベーマイト0.2 4 w t %を分散したゾルをパイレックスガラス上にスピンコートで塗布した後、500℃のホットプレート上で20秒間焼成するというサイクルを5回繰り返し、透明膜を作製した。との透明膜を、当量の水で加水分解したフルオロアルキルシランの2%メタノール溶液に40分間を浸した30後、140℃で20分間乾燥して撥水処理を行って滑水性膜を得た。

【0065】得られた滑水性膜は、平均細孔径200 n mの微小多孔構造を有しており、その接触角は155℃であったが、7 m g の液滴の転落角は30°程度であり、その硬度は鉛筆硬度で3Bであった。

【0066】比較例2

アクリルポリマーを添加しないで調製したということ以外は上記実施例1に係る塗布剤と同一の組成の塗布剤を単独で調製し、上記実施例と同じ方法で成膜及び撥水処 40 理を行った。

【0067】得られた膜は、緻密透明で、硬度は鉛筆硬度で8 H と高く、接触角は133°であったが、90° に膜を傾けても7 m g の液滴は転落せず、滑水性が発現していなかった。

【0068】実施例2

エタノール:10g、濃HC1:0.6g、テトラエチルオルソシリケート:1.0gを19時間混合し、これにメチルエチルケトン(MEK)に親和性を示す市販のシリカゾル(粒径:15nm)を添加して1500rpmでスピンコートを行った。これに熱CVDで実施例1と同様の方法で撥水処理を行ったところ、水の接触角152°、7mgの液滴の転落角30°、鉛筆硬度3Hの高硬度超撥水膜が得られた。この膜は1次粒径15nmのシリカゾルが600nmの団粒構造を2次的に形成し10た二重粗さ構造となっていた。SEM写真を図8に示す。

12

【0069】比較例3

実施例2のMEK系シリカゾルの代わりに、エタノール中での分散性に優れたアルコール系シリカゾル(粒径:15nm)を用いた。その結果、接触角は131°どまりで7mgの液滴は90°傾けても転落しなかった。【0070】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 制御された構造の高硬度高滑水性膜を容易に作製するこ とができる。これは各種の工業製品に好適に使用可能で あり、広範囲の用途に寄与するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1に係る溶媒、金属アルコキシド、及びボリマーの3成分からなる3成分系の相図を示した図である。

【図2】実施例1に係る分相の形成スキームを示した図である。

【図3】実施例1に係る、想定された分相の状態を示した図である。

60 【図4】実施例1によって得られた微小多孔質の表面の SEM写真を示した図である。

【図5】図4に示される微小孔の断面の想定図である

【図6】第1の凹凸面のみを有する基材を模式的に示した概略断面図である。

【図7】第1の凹凸面上に第2の凹凸面が形成された基材を模式的に示した概略断面図である。

【図8】実施例2によって得られた膜表面のSEM写真 を示した図である。

【符号の説明】

40 1 クレーター状の微小孔

2 基材表面

10、20 基材

11、21 第1の凹凸面

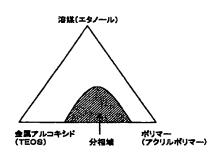
12 第1の凹凸面の斜面

13、23 液滴

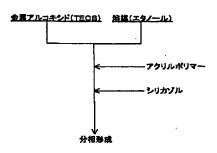
22 第2の凹凸面

【図1】

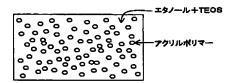
ţ



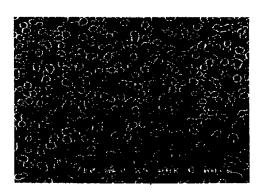
【図2】



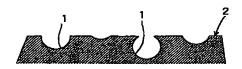
【図3】



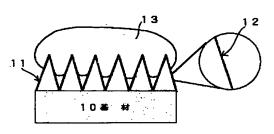
【図4】



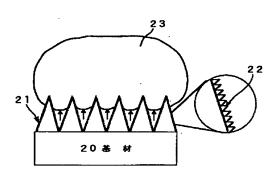
【図5】



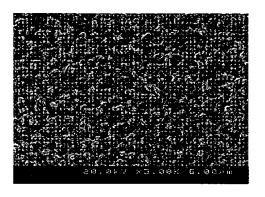
【図6】



【図7】



【図8】





フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

104

C 0 9 K 3/18 // C 0 9 D 133/00

183/02

(72)発明者 橋本 和仁

神奈川県横浜市栄区飯島町2073番地2 ニ

ューシティ本郷台D棟213

(72)発明者 藤嶋 昭

神奈川県川崎市中原区中丸子710番地5

FΙ

C 0 9 K 3/18

104

C O 9 D 133/00

183/02

Fターム(参考) 4D075 AE03 BB28Z BB93Z CA02

CA34 CA36 CB06 CB33 DA06

テーマコート' (参考)

DA23 DB01 DB13 DB14 DB16

DB18 DB20 DC01 DC08 DC11

DC15 DC18 DC24 DC38 EA07

EA13 EA43 EB16 EB22 EB42

EC01 EC03 EC08 EC53

4H020 BA32 BA36

4J038 CG141 DL021 DM021 HA446

JA16 JA19 JC32 KA04 KA06

KA08 MA07 MA10 NA01 NA07

NA11

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.